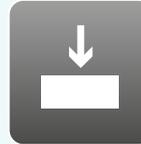
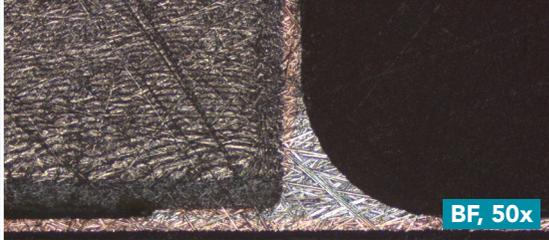
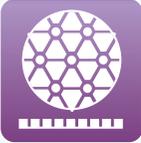
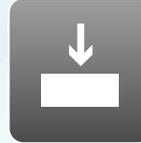
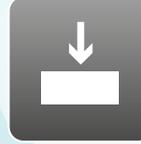
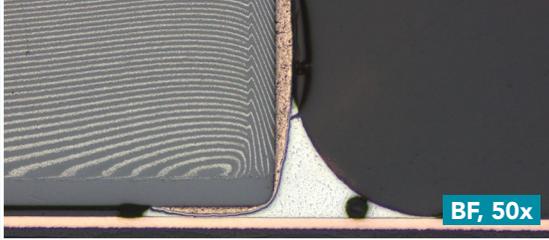


Aka-Brief #13 Composants électroniques

1						
	Rhaco Grit P320	Water	300 rpm	20 N	Until plane	BF, 50x
2						
	Largan 9	DiaUltra 9 µm	150 rpm	30 N	3:00 min	BF, 50x
3						
	Daran	DiaUltra 3 µm	150 rpm	25 N	3:00 min	BF, 50x
4						
	Chemal*	Fumed Silica 0.2 µm Alkaline**	150 rpm	15 N	2:00 min	BF, 50x

Les temps sont indiqués pour un système de préparation de 300 mm et les forces pour un échantillon individuel de 40 mm de diamètre.

Sur un système de 250 mm, les temps doivent être augmentés de 30 %, sur un système de 200 mm de 100 %.

La force doit être augmentée pour les échantillons plus grands et diminuée pour les échantillons plus petits.

La vitesse de rotation de la tête (porte-échantillon ou plaque porte-échantillon) utilisée est de 150 tr/min.

Le temps et la force peuvent varier en fonction de l'équipement.
* Avant le polissage aux oxydes, le tissu de polissage doit être mouillé avec de l'eau jusqu'à ce que le support touche le tissu de polissage.

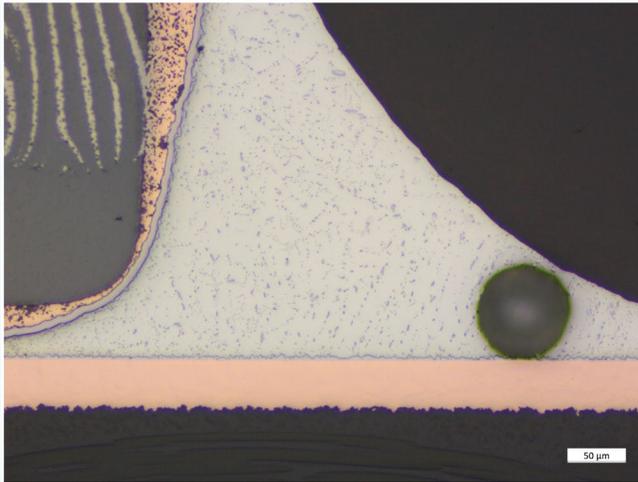
Le temps et la force peuvent varier en fonction de l'équipement.
* Avant le polissage aux oxydes, le tissu de polissage doit être mouillé avec de l'eau jusqu'à ce que le support touche le tissu de polissage.

** 96 ml Fumed Silica,
2 ml H₂O₂ (30%),
2 ml NH₄OH (25%).

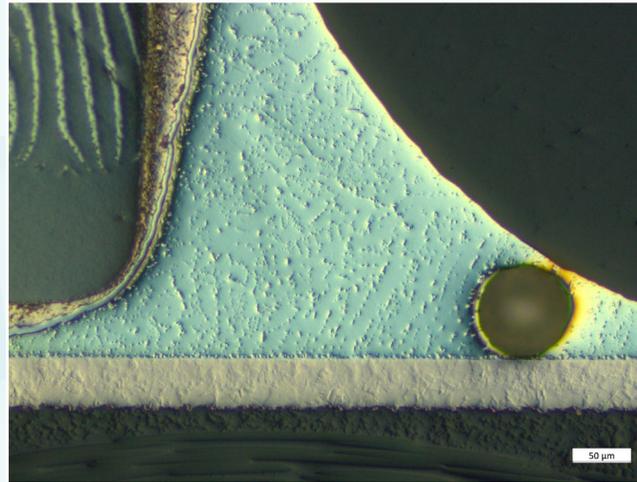
Le mélange doit être utilisé frais (dans les deux heures qui suivent) et remué régulièrement. Veuillez à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires lors de la manipulation des produits chimiques.

SOMEKO

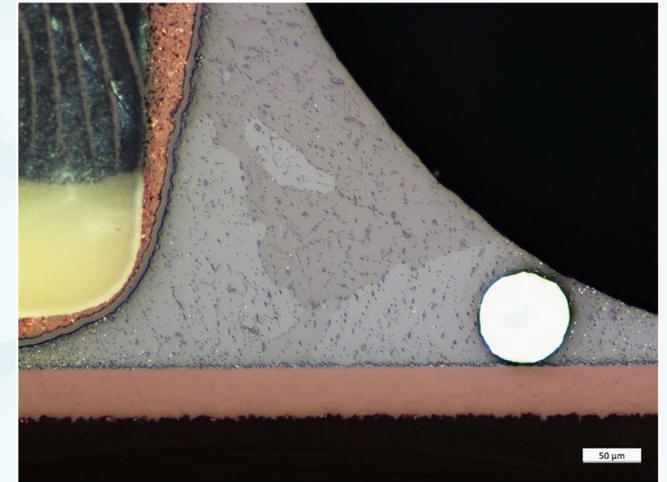
RÉSULTAT FINAL



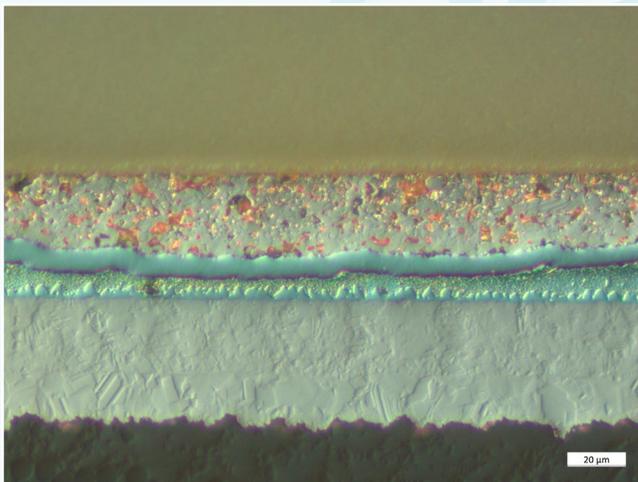
BF, 200x



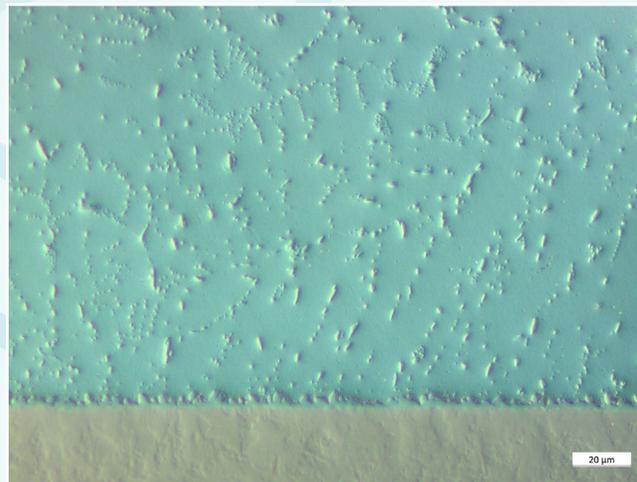
DIC, 200x



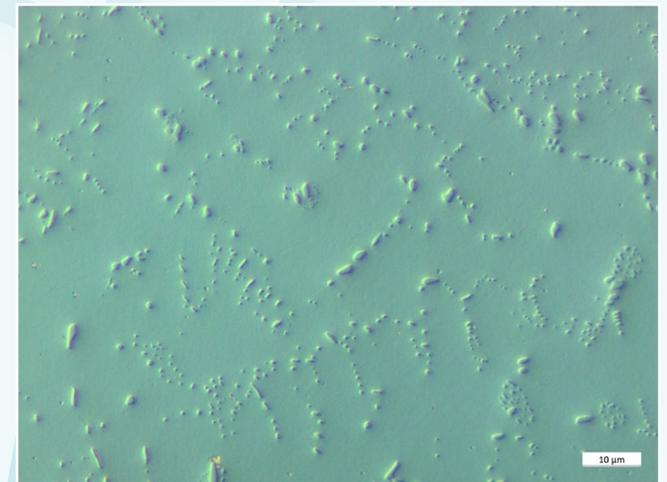
POL + Lambda Compensator, 200x



DIC, 500x



DIC, 500x



DIC, 1000x